

SILICON GRUND

Grund siliconic de impregnare

1. Generalitati si utilizari tipice.

- grund pe baza de rasina siliconica pentru vopsitorii si tencuieli siliconice, utilizat pentru grunduirea, amorsarea suprafetelor absorbante, in vederea reducerii si reglarii absorbabilitatii acestor suprafete si/sau pentru intarirea suprafetelor fragile la interior si exterior;
- aspect: lichid omogen alb-laptos
- se poate aplica pe orice suprafata de baza minerala precum: tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleduri de ipsos, beton, placi de gips – carton si pe tencuieli si vopsitorii vechi fragile si prafoase.

2. Elemente caracteristice principale:

- aderenta deosebita la suport, patrunde adanc in suprafata minerala intarind-o ;
- pelicula are o deosebita permeabilitate la vapori de apa si impermeabilitate la apa, umple foarte bine porii; rezistenta la solutii alcaline, variatii de temperatura, intemperii si la gaze industriale.

3. Caracteristici tehnice.

Aspect produs:	lichid omogen alb-laptos
ph	8 – 9
Aspect pelicula	lichid omogen alb-laptos

4. Instructiuni de aplicare.

Suprafete de baza indicate: toate suprafetele uscate si curate. Inainte de utilizare continutul din recipient se amesteca foarte bine.

Nr crt	Suprafata de baza (suport)	Pregatirea suprafetei	Grunduirea suprafetei
1.	Tencuieli vechi minerale foarte absorbante si/sau fragile	Se curata de praf sau mizerie	SILICON GRUND
2.	Zugraveli existente din huma sau var , vopsitorii de disperise existente si fragile, prafoase	Se inlatura complet in prealabil prin spalare sau raziure, iar zonele deteriorate se repara cu ipsos, materiale pe baza de ipsos	SILICON GRUND

5. Mod de aplicare.

- se aplica uniform, cu rola (trafalet) sau bidineaua nediluat sau diluat cu apa pina la max. 1:1, functie de caracterul de absorbabilitate al stratului suport, regula de baza fiind ca dupa uscare sa nu formeze pelicula (strat lucios); se vor efectua probe pe suprafete mici; dupa grunduire suprafata trebuie sa fie rezistenta la zgariere; daca nu s-a obtinut aceasta caracteristica se va mai aplica un strat
- nu se va lucra in conditii de: temperaturi foarte ridicate sub directa influenta a razelor soarelui, vint puternic, ceata, umiditate ridicata de peste 80% si pericol de ploaie si inghet;
- In conditiile temperaturilor ridicate si foarte ridicate este obligatoriu ca aplicarea grundului sa se faca pe latura fatadei care nu se afla direct expusa razelor solare;
- temperatura minima de aplicare: + 5°C pentru suprafata de baza si mediul inconjurator
- curatirea uneltelor de lucru se face cu apa sau apa cu detergent imediat dupa intrebuintare

6. Consumul specific mediu:

- suport neted – cca. 100-150 ml/m².
- suport cu granulatie medie - cca. 150- 200 ml/m²
- suport cu granulatie mare - cca. 200-250 ml/m².

Valoarea exacta a consumului specific se va determina in urma unei probe efectuate la fata locului. Pe suprafete foarte rugoase se va aplica corespunzator o cantitate mai mare.

7. Timp de uscare

La 20° C si 65% umiditate relativa a aerului;

- SILICON GRUND: 12 ore;

La temperaturi scazute si/sau umiditati mai mari este nevoie de un timp de uscare mai indelungat.

8. Ambalarea

Recipienti de 15 l din material plastic, inchisi etans, etichetati corespunzator.

9. Depozitare: La loc uscat la temperaturi cuprinse între + 5° C și + 30°C.

10. Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data fabricației, cu condițiile respectării prevederilor de ambalare și depozitare.